

資料２－水質汚濁防止法施行令別表第１（公害防止管理者等の配置が必要な工場のみ）

施行令別表第１	業種及び特定施設
２	畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 湯煮施設
３	水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設
４	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設
５	みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設 ヘ ろ過施設
６	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
７	砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ ろ過施設 ニ 分離施設 ホ 精製施設
８	パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
９	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
１０	飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸りゆう施設
１１	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設
１２	動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設
１３	イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設

（注１） \* 印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

（注２） \* 以外については、排出水量が１日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。

施行令 別表第1	業 種 及 び 特 定 施 設
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ 分離施設 ニ 洗だめ及びこれに類する施設
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
18の2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設
18の3	たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設
19	<p>紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ まゆ湯煮施設、ロ 副蚕処理施設、ハ 原料浸せき施設、ニ 精練機及び精練そう、ホ シルケット機 ヘ 漂白機及び漂白そう、ト 染色施設、チ 薬液浸透施設、リ のり抜き施設</p> <p>* 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。</p>
20	洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設
21	化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設
21の2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー
21の3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
21の4	パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 湿式パーカー ロ 接着機洗浄施設
22	<p>木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 湿式パーカー、ロ 薬液浸透施設</p> <p>* 上記の施設で、六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。</p>
23	<p>パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料浸せき施設 ロ 湿式パーカー ハ 碎木機 ニ 蒸解施設 ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設 チ 抄紙施設(抄造施設を含む。) リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設</p>

(注1) \* 印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

(注2) \* 以外については、排出水量が1日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。

施行令 別表第1	業 種 及 び 特 定 施 設
23の2	<p>新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 自動式フィルム現像洗浄施設、 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。</p>
24	<p>化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ ろ過施設、 ロ 分離施設、 ハ 水洗式破碎施設、 ニ 廃ガス洗浄施設、 ホ 湿式集じん施設</p> <p>* 上記の施設で、ふっ素もしくはその化合物を含有する物質、ほう素もしくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物もしくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。</p>
26	<p>無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 洗浄施設、 ロ ろ過施設、 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設、 ホ 廃ガス洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、カドミウムもしくはその化合物、鉛もしくはその化合物または水銀もしくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。</p>
27	<p>前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ ろ過施設、 ロ 遠心分離機、 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設、 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設、 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設、 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設、 ル 湿式集じん施設</p> <p>* 上記の施設で、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質（以下「有害物質」という。）又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。</p>
28	<p>カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 湿式アセチレンガス発生施設、 ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゅう施設 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゅう施設 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゅう施設、 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。</p>
* 29	<p>コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ ベンゼン類硫酸洗浄施設、 ロ 静置分離器、 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設</p>
30	<p>発酵工業（第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。）の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 蒸りゅう施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設</p>
31	<p>メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゅう施設、 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設</p> <p>* 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。</p>
32	<p>有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ ろ過施設、 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設、 ハ 遠心分離機、 ニ 廃ガス洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、トリクロロエチレンもしくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料もしくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。</p>

(注1) \*印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

(注2) \*以外については、排出水量が1日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。

施行令 別表第1	業 種 及 び 特 定 施 設
33	<p>合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 縮合反応施設、 ロ 水洗施設、 ハ 遠心分離機、 ニ 静置分離器、 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却  洗浄施設及び蒸りゅう施設、 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゅう施設、 ト 中圧法又は低圧法による  ポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設、 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設、 リ 廃ガス洗  浄施設、 ヌ 湿式集じん施設</p> <p><b>* 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふっ素樹脂の製造  の用に供するものに限る。</b></p>
34	<p>合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ ろ過施設、 ロ 脱水施設、 ハ 水洗施設、 ニ ラテックス濃縮施設、  ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器</p> <p><b>* 上記の施設で、テトラクロロエチレンを含有する物質を原料として使用する合成ゴムの製造の用に供す  るもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。</b></p>
35	<p>有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 蒸りゅう施設  ロ 分離施設  ハ 廃ガス洗浄施設</p>
36	<p>合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 廃酸分離施設  ロ 廃ガス洗浄施設  ハ 湿式集じん施設</p>
37	<p>前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理に  より製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、  次に掲げるもの  イ 洗浄施設、 ロ 分離施設、 ハ ろ過施設、 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゅう施設  ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゅう施  設  ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設  ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設  チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅう施設及び濃縮施設  リ 2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゅう施設  ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設  ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設  ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゅう施設  ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器  カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設  ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設  タ 廃ガス洗浄施設</p> <p><b>* 上記の施設で、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カド  ミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン  原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素  の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、  ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(ふっ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、  キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふっ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限  る。)又はアルキルベンゼン(ふっ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)の製造の用に供  するものに限る。</b></p>
38	<p>石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 原料精製施設  ロ 塩析施設</p>
39	<p>硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 脱酸施設  ロ 脱臭施設</p>
40	<p>脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設</p>
41	<p>香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの  イ 洗浄施設、 ロ 抽出施設</p> <p><b>* 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。</b></p>

(注1) \*印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

(注2) \*以外については、排出水量が1日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。

施行令 別表第1	業 種 及 び 特 定 施 設
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設
* 43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 脱水施設
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設
46	第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 水洗施設、ロ ろ過施設、ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設、ニ 廃ガス洗浄施設  * 上記の施設で、有害物質もしくはこれらを含有する物質を原料もしくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレンもしくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。
47	医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。) ホ 廃ガス洗浄施設  * 上記の施設で、水銀もしくはその化合物、鉛もしくはその化合物もしくは砒素もしくはその化合物もしくはこれらを含有する物質を原料もしくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレンもしくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設  * 上記の施設で、ほう素もしくはその化合物、ふっ素もしくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物もしくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。
49	農薬製造業の用に供する混合施設
50	第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 (水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質) ①カドミウム及びその化合物、②シアン化合物、③有機燐化合物 <sup>りん</sup> (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、④鉛及びその化合物、⑤六価クロム化合物、⑥砒素及びその化合物、⑦水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、⑧ポリ塩化ビフェニル、⑨トリクロロエチレン、⑩テトラクロロエチレン、⑪ジクロロメタン、⑫四塩化炭素、⑬1・2-ジクロロエタン、⑭1・1-ジクロロエチレン、⑮シス-1・2-ジクロロエチレン、⑯1・1・1-トリクロロエタン、⑰1・1・2-トリクロロエタン、⑱1・3-ジクロロプロペン、⑲チウラム、⑳シマジン、㉑チオベンカルブ、㉒ベンゼン、㉓セレン及びその化合物、㉔ほう素及びその化合物、㉕ふっ素及びその化合物、㉖アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物  * 上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの試薬の製造の用に供するものに限る。
51	石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 脱塩施設、ロ 原油常圧蒸りゆう施設、ハ 脱硫施設、ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設、ホ 潤滑油洗浄施設  * 上記の施設で、トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。
51の2	自動車用タイヤもしくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
51の3	医療用もしくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
52	皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設 ホ 染色施設

(注1) \* 印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

(注2) \* 以外については、排出水量が1日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。

施行令 別表第1	業 種 及 び 特 定 施 設
53	<p>ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 研磨洗浄施設、 ロ 廃ガス洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素もしくはその化合物もしくはふっ素化合物を原料として使用するガラスもしくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレンもしくはふっ素もしくはその化合物を使用する研磨洗浄の用に供するものに限る。</p>
54	<p>セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 抄造施設、 ロ 成型機、 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)</p>
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
58	<p>窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 水洗式破碎施設、 ロ 水洗式分別施設、 ハ 酸処理施設、 ニ 脱水施設</p> <p>* 上記の施設で、ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。</p>
59	<p>砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 水洗式破碎施設、 ロ 水洗式分別施設</p>
61	<p>鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設、 ロ ガス冷却洗浄施設、 ハ 圧延施設、 ニ 焼入れ施設、 ホ 湿式集じん施設</p> <p>* 上記の施設で、コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。</p>
62	<p>非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 還元そう、 ロ 電解施設(熔融塩電解施設を除く。)、 ハ 焼入れ施設、 ニ 水銀精製施設、 ホ 廃ガス洗浄施設、 ヘ 湿式集じん施設</p> <p>* 上記の施設で、銅、鉛もしくは亜鉛の第一次製錬もしくは鉛もしくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふっ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。</p>
63	<p>金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 焼入れ施設、 ロ 電解式洗浄施設、 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設、 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設</p> <p>* 上記の施設で、液炭浸炭による焼入れ、シアン化合物もしくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極もしくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。</p>
* 63の 3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
64	<p>ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設、 ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)</p> <p>* 上記の施設で、コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。</p>
65	<p>酸又はアルカリによる表面処理施設</p> <p>* 上記の施設で、クロム酸、ほう素もしくはその化合物、ふっ素もしくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物もしくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。</p>
66	<p>電気めっき施設</p> <p>* 上記の施設で、カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふっ素化合物またはアンモニウム化合物、亜硝酸化合物もしくは硝酸化合物を使用する電気めっきの用に供するものに限る。</p>
* 71の 5	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
* 71の 6	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

(注1) \*印の項の施設を設置している工場は、排出水量に関係なく、公害防止管理者等の選任が必要です。

(注2) \*以外については、排出水量が1日あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合、選任が必要です。